特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

REC'D 15 APR 2004 WIPO PET

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
出願人又は代理人 の書類記号 FP03-0093-00	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP03/04789	国際出願日 (日.月.年) 15	. 04. 03	優先日 (日.月.年)	15.04.	0 2	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. 7 (G11B7/26, G)3F7/26, 7,	/004			
出願人(氏名又は名称) 長瀬産業株式会社						
1. 国際予備審査機関が作成したこの 2. この国際予備審査報告は、この表稿 この国際予備審査報告には、 査機関に対してした訂正を含さ (PCT規則70.16及びPCT この附属書類は、全部で	紙を含めて全部で 附属書類、つまり補正 む明細書、請求の範囲	4 ペー されて、この報告の 及び/又は図面も添 シ照)	ジからなる。 基礎とされた及び			
この関係予備審査報告は、次の内容を含む。 I ※ 国際予備審査報告の基礎 II ※ 優先権 II ※ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 IV ※ 発明の単一性の欠如 V ※ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明ある種の引用文献 VI ※ 国際出願の不備 VI ※ 国際出願に対する意見						
国際予備審査の請求書を受理した日 14.11.2003		国際予備審査報告	を作成した日 1.04.200	4		
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JF 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4	5	特許庁審査官(権同権 均	3憲	5 D	3 0 4 5 5 5 0	

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/04789

	I. 国際予備審査報告の基礎						
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)							
×	出願時の国際	出願書類					
	明細告 明細告 明細告	第 第 	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求費と	共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
		第 第 第	項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基 国際予備審査の請求書と	づき補正されたもの		
	請求の範囲 図面 図面	第	ページ/図、				
	図面 明細書の配列 明細書の配列	第	ページ/図、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの			
明細書の配列表の部分 第ページ、 付の書簡と共に提出されたもの							
上記の書類は、下記の言語である 語である。 □ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 □ 3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。							
□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。							
4.] 明細審] 請求の範囲] 図面	図面の第		ージ/図			
5. 二 この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)							
				,			

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/04789

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性に 文献及び説明	ついての法第12条	(PCT35条(2)) k	C定める見解、それを裏付ける
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-6, 8 7, 9	
進歩性(IS)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-6, 8 7, 9	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-9	
		<u> </u>	
2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)			
・請求の範囲7及び9 文献1:JP 10-21589 A 1998.01.23 実施例	(日立化成工業株式 1 (ファミリー	に会社) -なし)	
文献2: JP 11-167205 A 1999. 06. 22 全文、	」(日本電気株式会	≷社)	
文献3:JP 10-301268 A	1.(日本電気株式会	ὲ社)	
文献4: JP 8-44061 A (F 1996. 02. 16 特許計	1本ゼオン株式会社	E)	
文献5: JP 5-181277 A 1993.07.23 特許記	(三菱化成株式会社	E)	
文献6: JP 5-323609 A 1993. 12. 07 【00	(東京応化工業株式	(会社)	
文献7: JP 2001-109165 2001. 04. 20 【00	5 A (クラリアント ジ	ヤパン株式会社)	•
文献8:IP 2001-291288	3 A(株式会社 F	日立製作所)	
2001.10.19 全文、 文献9:JP 2002-60641	A(信越化学工業	Ě株式会社)	
2002.02.26 特許記文献10:JP 6-150391 A	A(松下電器産業権	朱式会社)	
1994.05.31 【(文献11:JP 57-66546 A	A(三洋電機株式会	会社)	
1982.04.22 全 文献12:JP 2001-2436	62 A (ソニー	朱式会社)	
2001.09.07 全3 文献1の実施例1にはメトキシメチル	文、全図(ファミ)	リーなし)	ク用の原盤を製造する方
法が記載され、原盤をスタンパとして	用いることは同文的	訳の【0026】段	落に記載されているの
で、本願の請求の範囲7及び9に新規 また、文献2-7にはメトキシメチル	ル化メラミン化合物	物について、文献8	-10には光ディスク原
盤製造方法について、文献11,121 り、本願の請求の範囲7及び9に進歩	には原盤から直接原 性はない。	灭形する技術につレ	ててれてれ記取されてお

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/04789

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

・請求の範囲1-6,8

文献13: JP 4-77746 A (ソニー株式会社)

1992.03.11 全文、全図 (ファミリーなし)

文献14: JP 7-57995 A (株式会社東芝)

1995.03.03 全文、全図 (ファミリーなし) 文献15:JP 5-107769 A (富士通株式会社)

1993.04.30 全文、全図 (ファミリーなし)

文献16: JP 8-305036 A (沖電気工業株式会社) 1996.11.22 全文、全図 (ファミリーなし)

文献 1-16 は当該技術分野における一般的技術水準を示す文献であるが、光ディスク原盤の製造 方法において、メトキシ化メラミン化合物から成る層と半架橋レジストから成る層を用いる技術につ いては、記載も示唆もされていない。